

## ВЛИЯНИЕ БОЛЬШОГО ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТЕРМОЭДС Р-N ГЕТЕРОПЕРЕХОДА

## ГАДЖИАЛИЕВ М.М., ПИРМАГОМЕДОВ З.Ш.

Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН г.Махачкала, ул. М. Ярагского 94, Россия. E-mail: <u>ziyav@yandex.ru</u>.

Экспериментально исследованы «длинные» p- Ge- n - GaAs гетеропереходы. Измерена термоэдс гетероперехода в зависимости от величины разности температур на торцах от 10 до 180К, при постоянной температуре перехода равной 300К. Найдено что при большом градиенте температуры результаты измерения согласуется с теорией, учитывающей возникновение неосновных носителей вследствие тепловой эмиссии.

работах [1-6] представлены В результаты исследования термоэлектрических свойств p-n переходов и гетеропереходов. Найдено, что термоэдс гетероструктур состоит из вкладов от объёмных термоэдс и эдс Бенедикса p- и n- областей, а также барьерной термоэдс на самом гетеропереходе а. Установлено, что при небольшой разности температур, при которой выполняется неравенство

 $E_g \Delta T << k T_0^2$  (где E<sub>g</sub> - ширина запрещенной зоны

узкозонного материала;  $\Delta T$  – разность температуры на торцах структуры;  $T_0$  – температура гетероперехода; k – постоянная Больцмана), вычисленная величина эффективной термоэдс гетероперехода  $\alpha_{eff}$  согласуется с измеренной на эксперименте величиной.

В настоящей работе исследована термоэдс гетероперехода в случае, когда выполняется неравенство  $E_g \Delta T > kT_0^2$  т.е. при большом градиенте температуры.

Под большим градиентом температуры согласно [2], понимается градиент при котором изменяется концентрация носителей тока на длине свободного пробега.

Для проведения эксперимента были изготовлены "длинные" p-n гетероструктуры Ge-GaAs. Под длинными мы подразумеваем гетероструктуры, у которых размеры базовых областей (-A<sub>1</sub>)(-d<sub>1</sub>) и (d<sub>2</sub>B) намного больше ширины областей объёмных зарядов (-d<sub>1</sub>0) и (0d<sub>2</sub>) т.е. (-A<sub>1</sub>)(-d<sub>1</sub>) >> (-d<sub>1</sub>0) и (d<sub>2</sub>B) >> (0d<sub>2</sub>) (рис.1).

Гетеропереходы были получены по методике предложенной в работе [7]. Из n-GaAs и p-Ge были

пластинки прямоугольной изготовлены формы с размерами 0.1x1x3 мм<sup>3</sup> одинаковыми . После шлифовки и травления пластинки электронного арсенида галлия дырочного германия И накладывались друг на друга таким образом, чтобы получалась общая длина 4мм. Затем образцы помещались в вакуумную установку и в атмосфере проточного гелия, перпендикулярно области наложения пластинок друг на друга создавался большой градиент температуры, при котором материал с более высокой температурой плавления (арсенид галлия) оказывался со стороны высокой температуры. С ростом градиента температуры, когда плоскость германия, граничащая с арсенидом галлия, начинала расплавляться, сразу выключался нагрев, расплавленный слой снова кристаллизовался и Рентгеноструктурный возникал гетеропереход. анализ показал. что перекристаллизованная пограничная область между германием и арсенидом галлия является монокристаллической и пограничные плоскости арсенида галлия и германия повернуты относительно друг друга не более чем на 3<sup>0</sup>.

Вольтамперная характеристика (ВАХ) полученных описанным способом гетеропереходов Ge-GaAs аналогична ВАХ, полученной Андерсоном на гетеропероходе созданном эпитаксией германия на поверхность арсенида галлия [7], что говорит о хорошем качестве гетеропереходов.

Изготовленные, таким способом, гетеропереходы заправлялись в установку для измерения термоэдс [8].

Была измерена зависимость термоэдс Ge-GaAs гетероперехода от величины градиента температуры при одной и той же средней температуре гетероперехода в двух случаях: 1) когда поток тепла

направлен от германия к арсениду галлия; 2) когда поток тепла направлен от арсенида галлия к германию.

В работе[4] показано, что в отличие от вентильной фотоэдс барьерная термоэдс  $\alpha_b$  может иметь не только пропускное (прямое) направление (со знаком "+" на р-области и знаком "-" на п-области), но также запирающее (обратное) направление — в зависимости от расположения температурных градиентов и физических параметров р-п-структуры. Далее первый случай, когда тепловой поток направлен от германия к арсениду галлия отмечен знаком (+), а случай обратного направления теплового потока знаком (–).



Рис.1. Энергетическая диаграмма p-n Ge-GaAs гетероперехода в отсутствии градиента температуры и два варианта распределения температуры вдоль оси х:  $E_c, E_v$  — зона проводимости и валентная зона,  $\Delta E_c, \Delta E_v$ , — соответствующие разрывы зон на гетерогранице,  $E_f$  — уровень Ферми. 1 — направление (+); 2 — направление (-).

На рис.2 представлены графики зависимостей термоэдс от величины разности температур между горячим и холодным торцом гетероперехода при одной и той же средней температуре равной 300К. Кривая 3 получена при тепловом потоке (+), а зависимость 4 – при тепловом потоке (–). Кривая 1 – зависимость средних для двух направлений потоков тепла значений термоэдс  $\alpha_{eff}^{av}$ .

На этом же рисунке (кривая 2) представлены значения термоэдс, вычисленные по формуле, выведенной в работе [3] для эффективной термоэдс гетероперехода при большом градиенте температуры  $E_g \Delta T > kT_0^2$ :

$$\alpha_{eff} = \frac{K}{e} \frac{T_0}{\Delta T} \ln\{1 + (1 + \frac{d_1}{L_n})[(1 + \frac{3\Delta T}{T_0})e^{\frac{E_{g1}\Delta T}{kT_0^2}} - 1]\}$$
(1)

где  $T_0$  – средняя температура гетероперехода;  $\Delta T$  – разность температуры между горячим и холодным торцами гетероперехода;  $E_{g1}$  - ширина запрещенной зоны узкозонного материала (германия)

равная 0,74 эВ ;  $d_1$  - ширина области объёмного заряда в узкозонном материале;  $L_n$  – диффузионная длина неосновных носителей тока.



Рис.2. Зависимости термоэдс p-n гетероперехода Ge-GaAs от разности температур  $\Delta T$  на торцах при средней температуре 300К: 1 –средние значения термоэдс  $\alpha_{eff}^{av}$ ; 2 – расчет при большом градиенте температуры согласно (1); 3 –  $\alpha_{eff}$  при тепловом потоке (+); 4 –  $\alpha_{eff}$  при тепловом потоке (-);

Формула (1) верна в случае больших  $\Delta T$ , при которых, благодаря термической эмиссии в объёме гетероперехода возникают неосновные носители тока. Большими считаются, как было отмечено выше, разности температур, для которых выполняется  $E_g \Delta T > kT_0^2$ . В нашем случае неравенство последнее неравенство выполняется при  $\Delta T > 80 K$ . Поэтому, на рис.2 приведены значения  $\alpha_{eff}$ вычисленные по формуле (1) для  $\Delta T \ge 80 K$ . Как видно из рисунка, в облости  $\Delta T > 80 K$  средние значения термоэдс при двух противоположных потоках тепла близки к вычисленным значениям а<sub>eff</sub>. Последнее указывает на то, что только при большом градиенте температуры реализуется случай, когда определяющую роль в термоэдс гетероперехода термоэдс неосновных играет носителей тока, создаваемых тепловой эмиссией.

обработки При описанной выше процедуре экспериментальных результатов  $\alpha_{eff}^{av}$ состоит в основном только из барьерной термоэдс α<sub>b</sub>, поскольку все остальные составляющие (объёмные термоэдс "базовых" областей, термоэдс Бенедикса р-и nобластей) сокращаются при усреднении вследствие изменения их знака при смене направления теплового потока. Меняется знак и барьерной термоэдс но поскольку, величины  $\alpha_b$  при тепловых потоках (+) и разные вследствие того, что при разных (-) направлениях потоков тепла различаются концентрации неосновных носителей, поступающих из области p-Ge в область n-GaAs и наоборот, возникают в обоих случаях разные по величене и противоположные по знаку барьерные термоэдс  $\alpha_b$ ; в результате получаем среднее значение  $\alpha_{eff}^{av}$  отличные от нуля.

Исходя из изложенного можно утверждать, что при больших  $\Delta T$  вычисленная по формуле (1)  $\alpha_{eff}$  согласуется с экспериментальными значениями  $\alpha_{eff}^{av}$ .

- [1]. Б.Л. Шарма, Р.К. Пурохит. Полупроводниковые гетеропереходы. М.: Советское радио, 1979.
- [2]. Я. Тауц, Фото-и термоэлектрические явления в полупроводниках. М.:ИЛ,1962.
- [3]. Н.С. Лидоренко, И.И Балмуш, З.М. Дашевский, А.И. Касиян, Н.В. Коломоец. Доклады АН СССР, т. 272, с. 855, (1983).
- [4]. И.И. Балмуш, З.М. Дашевский, А.И. Касиян. ФТП, т. 29, с. 1796, (1995).
- [5]. И.И. Балмуш, З.М. Дашевский, А.И. Касиян. Термоэлектрические эффекты в многослойных полупроводниковых структурах. (Кишинёв, Штииннца, 1992).
- [6]. R.H. Rediker, S. Stopek, J.H.R. Ward. Solid-State Electron, v. 7, p. 621, (1964).
- [7]. R.L. Anderson. Solid-State Electronics, v. 5, p. 341, (1962).
- [8]. М.М. Гаджиалиев, В.А Елизаров. ФТП, т. 32, с. 1313, (1998).